

附件二

「擬定及變更原高雄市都市計畫細部計畫(原中油公司高雄煉油廠土地-配合新建半導體廠房)案」變更前座談會

計畫摘要說明

一、計畫目的及變更緣由

行政院 110 年 4 月「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」以位於楠梓區之原高雄煉油廠為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為新興半導體製造聚落，南接大社、仁武、大寮、林園、小港(大林蒲)半導體材料、石化聚落，並結合台積電、日月光、華邦電、穩懋等半導體廠，建立南部半導體材料 S 型廊帶。行政院自 110 年 11 月 5 日至 111 年 10 月 27 日召開 6 次「研商科學園區籌設相關事宜-楠梓產業園區籌設作業」會議，整合協調半導體大廠布局相關籌設事宜，由高雄市政府先行啟動於原高雄煉油廠區依《產業創新條例》報編設置楠梓產業園區 29.83 公頃，完成環境影響評估、都市計畫變更、土壤及地下水污染整治等作業，並解決用水(含再生水)、用電、污水處理、空污抵減等事項，再由南部科學園區管理局(以下簡稱南科管理局)接續辦理原高雄煉油廠全區籌設為科學園區，行政院於 112 年 7 月 14 日核定「南部科學園區擴建高雄第三園區(楠梓園區)籌設計畫」(以下簡稱楠梓園區籌設計畫)。

承上，台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱本公司)於楠梓產業園區已於 111 年 9 月取得建照啟動第 1 期及第 2 期建廠，興建工程持續進行中，而面臨全球半導體產業供應鏈轉變及需求，以及產業製程全球布局考量，本公司仍具緊迫之建廠營運需求，擬於楠梓園區籌設計畫之範圍內勘選土地啟動第 3 期建廠，以延續先進製程、發揮產能群聚綜效。

綜合上述，考量本公司產業類別非屬都市計畫法高雄市施行細則所定特種工業區土地使用容許業別，為符法制，有鑑高雄市都市計畫尚無通盤檢討規劃，且本公司高雄 3 期建廠期程窘迫，實有參據都市計畫法第 27 條第 1 項第 3 款或第 4 款規定，循細部計畫個案變更程序將所需用地自特種工業

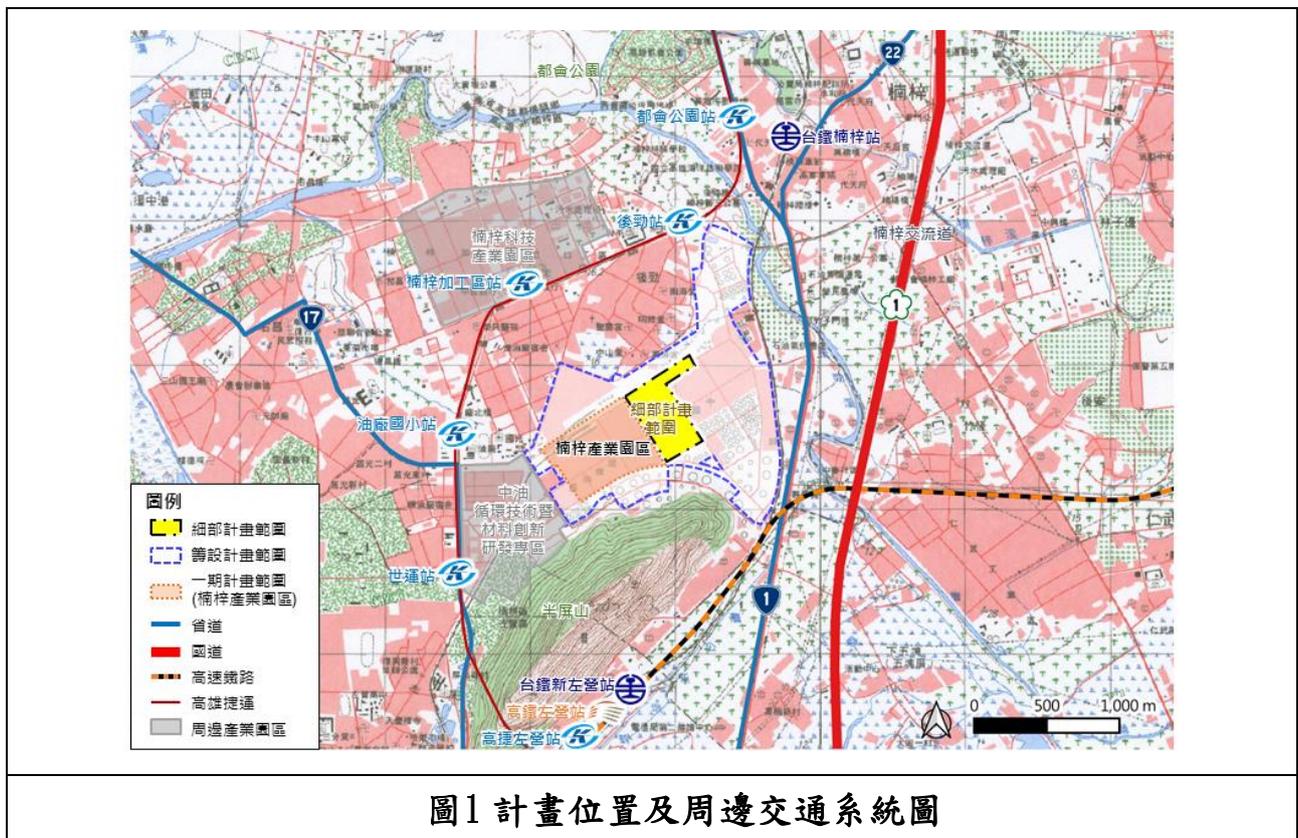
區變更為甲種工業區之需要，辦理辦理本次擬定及變更細部計畫。

二、區位及計畫範圍說明

計畫範圍位於高雄市楠梓區之原高雄煉油廠區範圍內，北側鄰近後勁聚落、宏毅宿舍，西側鄰近文化景觀「日本第六海軍燃料廠(中油宏南宿舍群等)」、中山大學附屬中學、油廠國小，南側則鄰近半屏山。

另以交通位置論之，本計畫西側鄰近高雄捷運油廠國小站、台17線；東側則有台1線、國道1號，周邊道路及大眾運輸系統發達，可利用台17線或高雄捷運紅線前往高鐵左營站(臺鐵新左營站)，亦可經由北側地區道路由楠梓交流道連接國道1號，往來市區與城際間交通便利，如圖1所示。

本次變更範圍為配合本公司新建半導體廠房，總面積約17.2公頃，係配合土污整治進度、本公司需地面積與時程、既有設施物及中油公司目前尚使用中之範圍等原則下進行劃設，細部計畫範圍詳圖2。



註：細部計畫範圍及面積應以核定計畫書圖實地分割成果為準。

資料來源：本計畫繪製。



註：細部計畫範圍及面積應以核定計畫書圖實地分割成果為準。

資料來源：1.高雄市都市計畫地理資訊系統。2.本計畫繪製。